

# 超高密度SROターゲット

従来、当社製SrRuO<sub>3</sub>は密度60%と低く、また大型サイズは歩留まりが極めて悪いため高コストとなり生産用途には不向きな品質でした。しかしこのたび、某企業との協力によりSrRuO<sub>3</sub>の高密度化に成功し、最大φ12"の大型化も実現しました。下記に添付しているXRD回析データからは、単相構造となっていることが確認できます。

## <実製品(φ12")画像>



## <製品データ>

純度：3N 以上

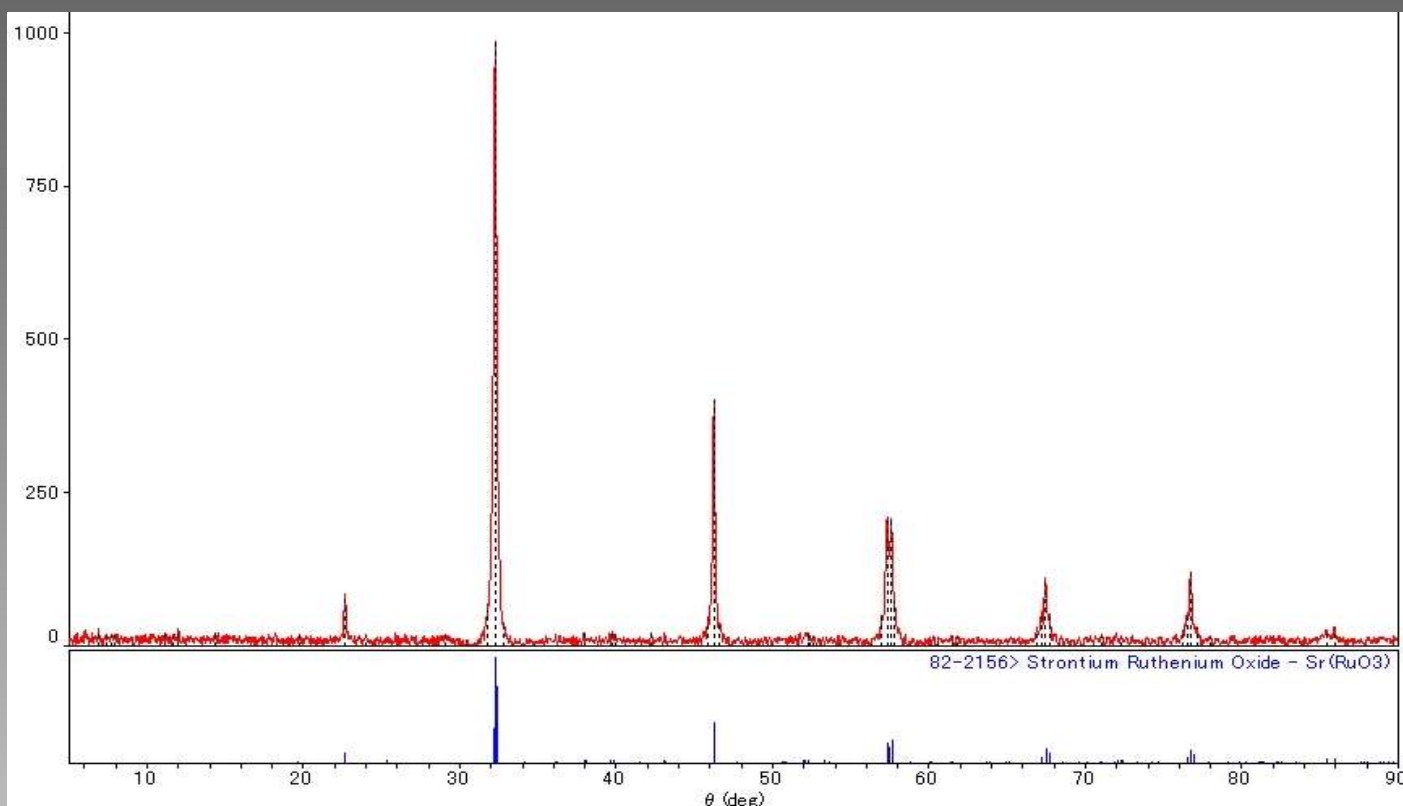
密度：90% 以上

抵抗値：1.0E-3 Ω・cm 以下

最大実績サイズ：φ12"

※φ12"以上のサイズについては要相談

## <ターゲットXRD回析データ>



※代理店経由での販売となります

**TOSHIMA** Manufacturing Co., Ltd.  
Materials system division

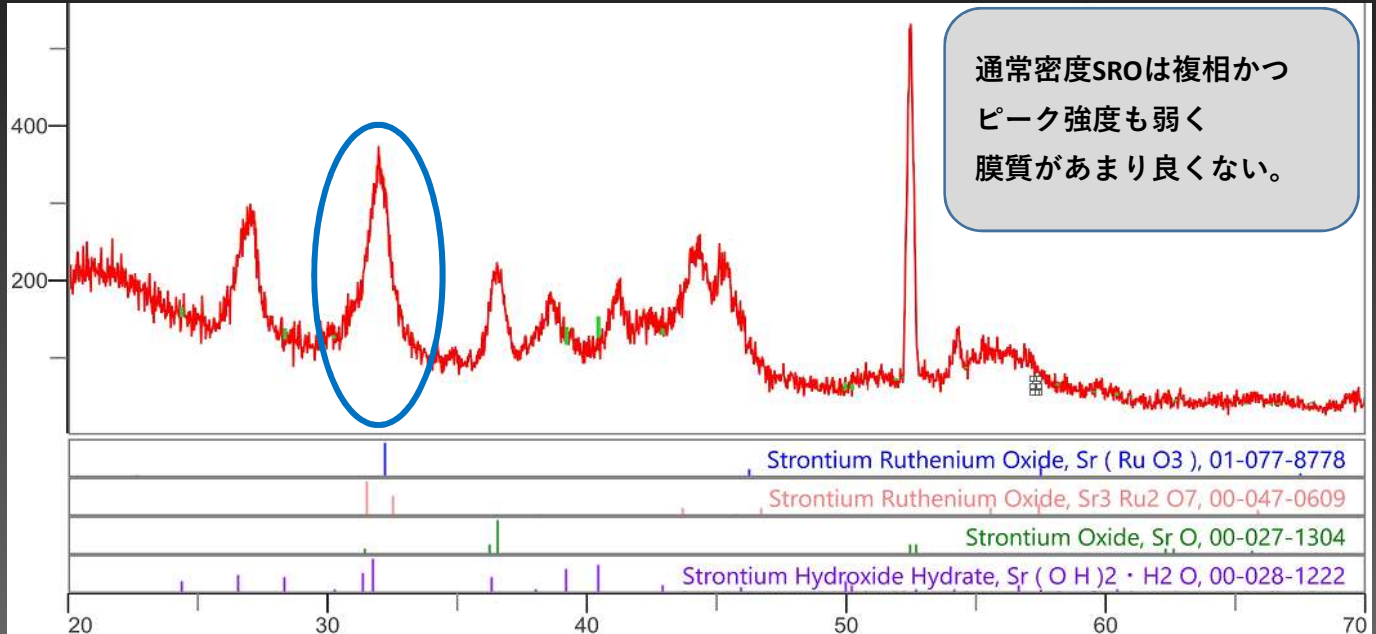
株式会社 豊島製作所 マテリアルズシステム事業部  
〒355-0036 埼玉県東松山市下野本1414  
TEL:0493-24-6774  
URL:<http://www.material-sys.com>

# 通常密度SRO(密度約60%)と超高密度SRO(密度90%up)の膜比較データ

( 成膜条件：基板：Si、膜厚：100nm、基板加熱温度：約550℃ )

## <通常密度SRO(密度約60%)>

- ・膜抵抗： $2.9\text{E-}03\Omega\cdot\text{cm}$
- ・XRD



## <超高密度SRO(密度90%up)>

- ・膜抵抗： $1.9\text{E-}04\Omega\cdot\text{cm}$
- ・XRD

